

1. 事業報告

先端材料・技術入門講座2を開催しました

2017年12月5日(火) 13:30~16:30に、『先端材料・技術入門講座2 ~新しい繊維産業がやってくる!~』を開催しました。

本講座の前半では『新しい繊維産業やってくる!』と題して、堀照夫(産学官連携本部 客員教授)が講演をいたしました。世界各国のスマートテキスタイルの研究開発動向や、テクテキスタイル2017での内容を説明し、最新のスマートテキスタイルを受講者に知っていただきました。

堀客員教授は「日本はヨーロッパに比べ、スマートテキスタイルの普及が遅れている。普及させていきたい。」と述べておられました。また、超臨界染色の原理や研究開発、世界各国の動向についても説明されました。「日本は中国・台湾に比べ、超臨界染色の実用化が遅れており、実用化を進めていきたい。」と抱負も述べておられます。

本講座の後半では、『超臨界乾燥を用いた p-アラミドゲルの調製』と題して、廣垣和正氏(本学工学研究科 准教授)にご講演をいただきました。始めに超臨界乾燥やエアロゲルの特性を丁寧に説明いただいた後、超臨界乾燥を用いた p-アラミドゲルの調製について説明していただきました。



(講座の様子)

2. 事業報告

オージェ電子分光法講習会を開催しました。

2017年12月7日(木)と8日(金)に、『オージェ電子分光法(AES)講習会』を開催しました。

7日はAES基礎講座を開講し、午前中はAESの原理や実用例についての講義を受講後、AESの実演を見学していただきました。午後からは、受講者が持参したサンプルの測定を行い、より理解を深めました。

8日はAES応用講座を開講し、より高度な測定技術について受講していただきました。



(講習会の様子)

3. 事業報告

日本酒づくりプロジェクトの純米大吟醸「福の愉(たのしみ)」のお披露目会を行いました

2018年1月15日(月)に、日本酒づくりプロジェクトの純米大吟醸「福の愉(たのしみ)」のお披露目会を行いました。

本プロジェクトは、地(知)の拠点大学による地方創生推進事業(COC+)の「福井ブランド創出部門:日本酒作りプロジェクト」の一環で行われ、「起業化経営論(産学官連携本部 竹本拓治准教授)」の受講生を中心とした約40名が、米作り・酒作り・デザイン・営業の4チームに分かれて、昨年6月から活動してきました。

営業チームのリーダーの長谷川航平君は、プロジェクトの活動報告や福の愉について説明し、「福

の愉は冷やして飲むのがお勧めです。福井の名産であるへしこと合わせて飲んでいただきたいです。」と述べていました。

福の愉は、2018年2月より、各小売店の他、吉田酒造社にご連絡いただければ、お求めいただけます。また、2月3日にふくい南青山291（東京都青山）、2月4日に食の國 福井館（東京都銀座）にて、試飲及び販売会を行います。



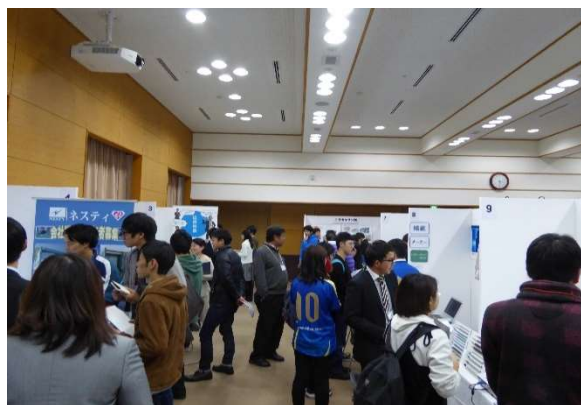
(日本酒とプロジェクトに携わった学生達)

4. 事業報告

キャリアアップセミナーを開催しました

2017年12月15日（金）に、『キャリアアップセミナー』を開催しました。今年は71社の企業様にご参加いただきました。来場学生数は234名にのびりました。

セミナーでは、企業がブースで企業の魅力や業界を紹介する『企業研究セミナー』『企業によるミニプレゼンコーナー』と『大学院進学コーナー』『相談コーナー』を設けました。学生は熱心に説明を聞き、質問をしている様子が視えました。



(セミナーの様子)

5. 事業報告

FUNTEC フォーラムを実施しました

2017年1月24日（水）14:00～18:00に、福井商工会議所にて『FUNTEC フォーラム』を開催いたしました。今年は、第1部（14時～14時50分）にシーズ発表会（ポスター展示）を行い、第2部にFUNTEC フォーラム全体会議を行いました。第2部の特別講演には、伊藤泰信氏（北陸先端科学技術大学院大学 知識科学系 知識マネジメント領域 准教授）が「現場の課題や消費者ニーズを”エスノグラフィ”する—文化人類学の実務への活用可能性」と題し、ご講演されました。

エスノグラフィについて、日本の事例等を踏まえて分かりやすくご講演していただきました。伊藤氏は「人類学の視覚及び方法論（エスノグラフィ）の特徴や強みを企業様が実務に導入する際に整理をしていきたい。」と述べられていました。

フォーラムの最後に交流パーティーを開催し、大学と産業界の交流を行いました。また、日本酒プロジェクトで開発された「福の愉」の紹介し、参加者に試飲していただきました。



(フォーラムの様子)

[今後の予定]

知財フォーラム

日時：3月7日

会場：総合棟13階 会議室

トップ懇談会

日時：3月14日

会場：総合棟13階 会議室

(平成30年2月1日発行)